(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2005 年12 月15 日 (15.12.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/119748 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/304

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/010034

(22) 国際出願日: 2005 年6 月1 日 (01.06.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-167246 2004 年6 月4 日 (04.06.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目３番６号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 関口 賢治 (SEKIGUCHI, Kenji) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢６５０番地 東京エレクトロンＡＴ株式会社内 Yamanashi (JP). 大野 広基 (OHNO, Hiroki) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢６５０番地 東京エレクトロンＡＴ株式会社内 Yamanashi (JP).

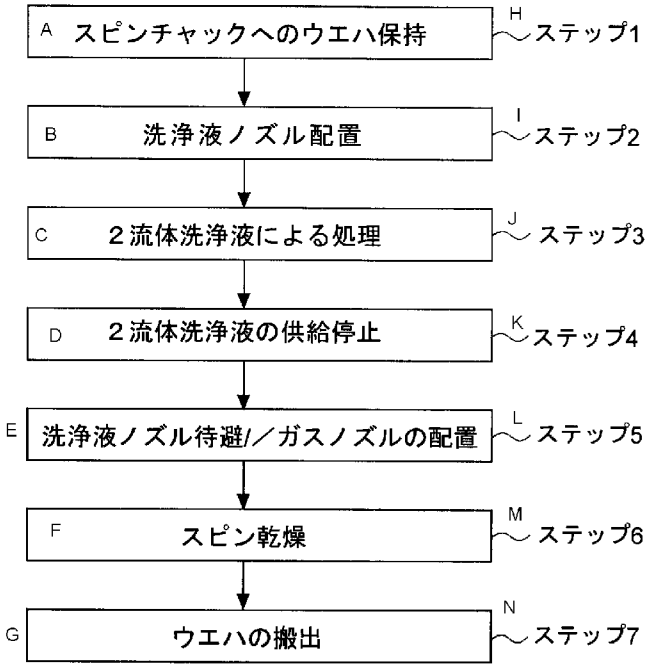
(74) 代理人: 高山 宏志 (TAKAYAMA, Hiroshi); 〒2220033 神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１８番９号 新横浜ＩＣビル６階 Kanagawa (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ,

[続葉有]

(54) Title: SUBSTRATE CLEANING METHOD AND COMPUTER READABLE RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: 基板洗浄方法およびコンピュータ読取可能な記憶媒体



A... HOLDING WAFER ON SPIN CHUCK
B... ARRANGING CLEANING SOLUTION NOZZLE
C... TREATMENT BY TWO-FLUID CLEANING SOLUTION
D... STOPPING SUPPLY OF TWO-FLUID CLEANING SOLUTION
E... RETRACTING CLEANING SOLUTION NOZZLE/ARRANGING GAS NOZZLE
F... SPIN DRYING
G... CARRYING OUT WAFER
H... STEP 1
I... STEP 2
J... STEP 3
K... STEP 4
L... STEP 5
M... STEP 6
N... STEP 7

(57) Abstract: A wafer (W) is treated by supplying two-fluid or high-pressure jet water or megasonic water, while rotating the wafer (W) almost horizontally. After stopping supply of such cleaning fluids, without performing rinse treatment with pure water, the wafer (W) is rotated at a higher speed than that when the cleaning fluids are supplied, and the water (W) is dried.

(57) 要約: ウエハWを略水平姿勢で回転させながら２流体または高圧ジェット水またはメガソニック水を供給してウエハWを処理し、これらの洗浄流体の供給を停止した後に純水によるリンス処理を経ることなく、ウエハWをこれら洗浄流体の供給時よりも高速で回転させてウエハWを乾燥させる。

WO 2005/119748 A1

NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 *(*表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能*)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。